



## ごあいさつ

常務取締役 新田 和久  
Nitta Kazuhisa

日頃より、当社製品・サービスをご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

昨年5月に新型コロナウイルスの感染症法における位置付けが変更されて1年が経過し、金利差を背景とした円安も相まって、旅行者の著しい増加がもたらす「オーバーツーリズム」問題が京都でも再燃しております。

当社を取り巻く事業環境は、電力・環境システム事業分野では、再生可能エネルギーの拡大に向けた広域連系系統投資計画の具体化等により国内電力会社向けの需要が増加し、また、工場建設などに伴う電力設備の新設・更新需要が高水準に推移しております。ビーム・プラズマ事業分野では、主力のイオン注入装置において、EV(電気自動車)向け需要を背景としたSiC(シリコンカーバイド)パワー半導体メーカーの積極的な設備投資が続き、電子線照射装置や自動車部品向け等のファインコーティングサービスの需要も堅調に推移しております。タイ・ベトナム・ミャンマーで展開している装置部品ソリューション事業分野では、半導体製造装置の在庫調整に伴う設備投資抑制の影響を受け依然として需要は低調ですが、回復の動きも出始めております。

このような事業環境の中、SDGs(持続可能な開発目標)を中核に据えた中期経営計画「VISION2025」では「日新一新<sup>(\*)1</sup>」「変化への適応・変化の創造」の方針の下、「①環境配慮製品の拡大、②分散型エネルギー対応、③再生可能エネルギー対応、④DXの製品・事業への適用、⑤新興国環境対応需要の捕捉、⑥EV拡大に伴う事業拡大」の6つの成長戦略に取り組んでおります。本年2024年は、その成果の刈り取りに向けた取組みを加速させる年であります。電力・環境システム事業分野では環境対応型受変電設備「ECSS<sup>(\*)2</sup>(Environment & Compact SubStation)」の開発や「SPSS<sup>(\*)3</sup>(Smart Power Supply Systems)」を含めたソリューション提案を、また、ビーム・プラズマ事業分野では需要急拡大が期待されるSiCパワー半導体用イオン注入装置の高機能化や大型化するガラス基板に対応したフラットパネル製造用イオン注入装置の開発に取り組んでいます。

今回の技報の特集では、各部門における2023年の技術と成果を、また、一般論文では、先端半導体デバイスを製造する際の材料改質プロセスにおいて量産化に必要な種々の性能を満たす世界初の半導体材料改質装置「KYOKA<sup>(\*)4</sup>(鏡花)」の開発について、それぞれ掲載しております。是非ともご高覧賜り、ご意見・ご指導を頂戴できれば幸甚に存じます。最後になりましたが、ステークホルダー各位のますますのご繁栄をお祈りし、巻頭の挨拶とさせていただきます。

(\*1)「日新一新」は、日新電機(株)の登録商標です。  
(\*2)「ECSS」は、日新電機(株)の登録商標です。  
(\*3)「SPSS」は、日新電機(株)の登録商標です。  
(\*4)「KYOKA」は、日新イオン機器(株)の登録商標です。